

DC/RF-Labor-Sputteranlage

Anlagenbeschreibung

Die Laborsputteranlage LA 250 S (vonArdenne Anlagentechnik) besitzt 2 Quellen mit RF und DC-Versorgung (600 und 1500 W), die Möglichkeit zur Reinigung mittels Sputterätzler, BIAS-Spannung am Substrat, Einleitung von 3 externen Gasen, Totaldruckmessung und Plasma-Emmissions-Monitoring. Sie kann daher sehr variabel zur Herstellung metallischer oder keramischer Schichten in monolithischer, gradiert oder auch Mehrlagenanordnung im Bereich bis einigen μm Gesamtschichtdicke eingesetzt werden.

Probenrotationsvorrichtungen und Planetengetriebe erlauben die Beschichtung mehrerer Proben in einem Run (batch-Betrieb). Der maximal verwendbare Targetdurchmesser beträgt 90mm.

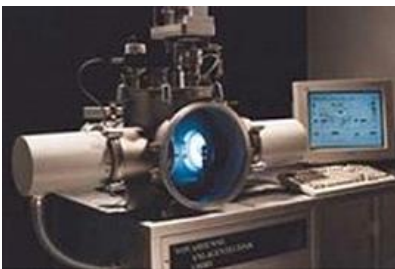
Anwendung

- Herstellung metallischer oder keramischer Schichten
- Beschichtung mehrerer Proben in einem Run

Kontakt

- Jörg Brien, DLR-Institut für Werkstoff-Forschung, Tel: +49 2203 601 2541, Fax: +49 2203 696480
- Jochen Krampe, Technologiemarketing, Tel: +49 2203 601 3665, Fax: +49 2203 695689

DC/RF-Labor-Sputteranlage



Dieses Handout sowie Querverweise zu verwandten Messtechniken und Anlagen finden Sie unter: <http://messtec.dlr.de/link-284-de>.